Aparatura chemiczna - podstawy

Kierunek studiów: Biznes Chemiczny I Stopień, II rok

Rok akademicki 2018/19

Wykład: **15 godz., środa 10:15-11:00, sala D2**

Odpowiedzialny za wykład: prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska, p. G202, mgr inż. Paweł Mazierski, p.G213

Wykładowcy: mgr inż. Paweł Mazierski, p.G213

TEMAT	TEMAT
I	Urządzenia do transportu ciał stałych, cieczy i gazów
II	Maszyny do rozdrabniania ciał stałych
III	Aparaty do mieszania materiałów sypkich, cieczy i układów o wysokiej lepkości
IV	Aparaty do rozdzielania układów ciecz-ciało stałe oraz ciecz- ciecz
V	Aparaty do rozdzielania układów gaz-ciało stałe i gaz-ciecz
VI	Aparaty do wymiany ciepła, aparaty wyparne, aparaty do wymiany masy

Literatura:

1. Błasiński H., Młodziński B., - Aparatura przemysłu chemicznego, WNT 1983
2. Bieszk H., - Urządzenia do realizacji procesów cieplnych w technologii chemicznej, Wyd. PG. 2010
3. Bieszk H., - Urządzenia do realizacji procesów mechanicznych w technologii chemicznej, Wyd. PG. 2001
4. Pikoń J., - Aparatura chemiczna, PWN 1978
5. Warych J., - Aparatura Chemiczna i Procesowa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2004